

501P06350900

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2000年 6月20日

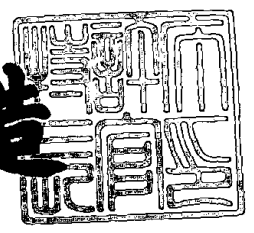
出 願 番 号
Application Number: 特願2000-189729

出 願 人
Applicant (s): ソニー株式会社

2001年 3月 2日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3014952

【書類名】 特許願

【整理番号】 0000456404

【提出日】 平成12年 6月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 3/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
内

【氏名】 山田 正裕

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
内

【氏名】 渡辺 哲

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代表者】 出井 伸之

【代理人】

【識別番号】 100094053

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐藤 隆久

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014890

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9707389

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学素子とその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の光学材料からなる基材と、

前記第 1 の光学材料とは屈折率が異なる第 2 の光学材料と

を有する光学素子であって、

前記基材は、互いに対向する第 1 および第 2 の面を有し、前記第 1 の面には第 1 の凹部が形成されていると共に、前記第 2 の面には第 2 の凹部が形成されており、

前記第 1 および第 2 の凹部には、前記第 2 の光学材料が充填されている光学素子。

【請求項 2】

前記第 1 および第 2 の凹部は、回転対称または略回転対称な形状を有し、

前記第 1 の面のうち前記第 1 の凹部の周囲には、第 1 の平坦部が形成されており、

前記第 2 の面のうち前記第 2 の凹部の周囲には、第 2 の平坦部が形成されており、

前記第 1 および第 2 の平坦部は、平行または略平行である

請求項 1 記載の光学素子。

【請求項 3】

前記第 1 の凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面と前記第 1 の平坦部は、平行または略平行であり、

前記第 2 の凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面と前記第 2 の平坦部は、平行または略平行である

請求項 2 記載の光学素子。

【請求項 4】

前記第 1 の凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面と前記第 1 の平坦部は、同一平面上または略同一平面上に位置し、

前記第 2 の凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面と前記第 2 の平坦部は、同一平面上または略同一平面上に位置する

請求項 3 記載の光学素子。

【請求項 5】

前記第 1 の凹部をその対称軸に沿って切断した場合における前記第 1 の凹部の表面の形状は、円弧または略円弧であり、

前記第 2 の凹部をその対称軸に沿って切断した場合における前記第 2 の凹部の表面の形状は、円弧または略円弧である

請求項 2 記載の光学素子。

【請求項 6】

前記第 1 および第 2 の凹部の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置する

請求項 2 記載の光学素子。

【請求項 7】

前記第 1 および第 2 の凹部は、同一または略同一の大きさである

請求項 6 記載の光学素子。

【請求項 8】

前記第 2 の光学材料は、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム、窒化ガリウム、チタンとニオブと酸素の化合物、チタンとタンタルと酸素の化合物、または、窒化ケイ素である

請求項 1 記載の光学素子。

【請求項 9】

前記第 2 の光学材料は、液状の光学材料であり、

前記第 1 の面には、前記第 2 の光学材料が満たされた前記第 1 の凹部を密閉する光学材料からなる第 1 の層が形成されており、

前記第 2 の面には、前記第 2 の光学材料が満たされた前記第 2 の凹部を密閉する光学材料からなる第 2 の層が形成されている

請求項 1 記載の光学素子。

【請求項 1 0】

前記第 1 および第 2 の層は、一定または略一定の厚さの膜であると共に、同一の光学材料からなり、

前記第 1 の層の厚さは、前記第 2 の層の厚さと同一または略同一であり、

前記第 2 の光学材料は、光学油または液晶である

請求項 9 記載の光学素子。

【請求項 1 1】

第 1 の光学材料からなる基材の凹部に、前記第 1 の光学材料とは屈折率が異なる第 2 の光学材料が充填された光学素子を製造する製造方法であって、

空洞に対して突出した凸部が前記空洞の対向壁に形成された金型により、前記凸部の形状を写した凹部が、対向する第 1 および第 2 の面に形成された前記第 1 の光学材料からなる基材を、モールド成形により生成する工程と、

前記モールド成形により生成された前記基材の前記第 1 および第 2 の面の前記凹部に、前記第 2 の光学材料を充填する工程と

を有する

光学素子の製造方法。

【請求項 1 2】

前記第 1 および第 2 の面の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を平坦化する工程をさらに有する

請求項 1 1 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 1 3】

前記対向壁の前記凸部は、回転対称または略回転対称な形状を有し、

前記平坦化する工程は、

前記対向壁のうちの一方の壁に形成された前記凸部の形状が写された前記第 1 の面の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 1 の面の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を研磨する工程と、

前記対向壁のうちの他方の壁に形成された前記凸部の形状が写された前記第 2 の面の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように

、前記第 2 の面の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を研磨する工程と

を有する

請求項 1 2 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 1 4】

前記対向壁の前記凸部を当該凸部の対称軸に沿って切断した場合における当該凸部の表面の形状は、円弧または略円弧である

請求項 1 3 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 1 5】

前記対向壁の前記凸部の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置しており、

前記第 1 および第 2 の面の前記凹部の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置する

請求項 1 4 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 1 6】

前記第 1 および第 2 の面の前記凹部は、同一または略同一の大きさである

請求項 1 4 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 1 7】

前記第 2 の光学材料は、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム、窒化ガリウム、チタンとニオブと酸素の化合物、チタンとタンタルと酸素の化合物、または、窒化ケイ素である

請求項 1 1 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 1 8】

前記第 2 の光学材料は、液状の光学材料であり、

前記第 2 の光学材料を充填する工程は、

前記モールド成形により生成された前記基材の前記第 1 の面の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 1 の面の前記凹部を光学材料からなる第 1 の層で密閉し、次に、前記第 2 の面の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 2 の面の前記凹部を光学材料からなる第 2 の層で密閉する工程を有する

請求項 1 1 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 1 9】

前記第 1 および第 2 の層は、一定または略一定の厚さの膜であり、

前記第 2 の光学材料は、光学油または液晶である

請求項 1 8 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 2 0】

前記第 1 および第 2 の層は、同一の光学材料からなり、

前記第 1 の層の厚さは、前記第 2 の層の厚さと同一または略同一である

請求項 1 9 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 2 1】

第 1 の光学材料からなる基材の凹部に、前記第 1 の光学材料とは屈折率が異なる第 2 の光学材料が充填された光学素子を製造する製造方法であって、

第 1 の光学材料からなる基材の、互いに対向する平坦または略平坦な第 1 および第 2 の面に、窓を有するレジスト膜を形成する工程と、

前記窓に対応する凹部を、エッチングによって前記基材の前記第 1 および第 2 の面に形成する工程と、

前記凹部が形成された前記基材から前記レジスト膜を除去する工程と、

前記レジスト膜が除去された前記基材の前記第 1 および第 2 の面の前記凹部に、前記第 2 の光学材料を充填する工程と

を有する

光学素子の製造方法。

【請求項 2 2】

前記第 1 および第 2 の面の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を平坦化する工程をさらに有する

請求項 2 1 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 2 3】

前記窓は、円形または略円形であり、

前記凹部は、回転対称または略回転対称な形状を有し、

前記平坦化する工程は、

前記第 1 の面の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 1 の面の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を研磨する工程と、

前記第 2 の面の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 2 の面の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を研磨する工程と

を有する

請求項 2 2 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 2 4】

前記第 1 の面の前記凹部をその対称軸に沿って切断した場合における当該凹部の表面の形状は、円弧または略円弧であり、

前記第 2 の面の前記凹部をその対称軸に沿って切断した場合における当該凹部の表面の形状は、円弧または略円弧である

請求項 2 3 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 2 5】

前記第 1 および第 2 の面の前記凹部の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置する

請求項 2 4 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 2 6】

前記第 1 の面に形成された前記レジスト膜の窓は、前記第 2 の面に形成された前記レジスト膜の窓と同一または略同一の大きさであり、

前記第 1 および第 2 の面の前記凹部は、同一または略同一の大きさである

請求項 2 4 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 2 7】

前記第 2 の光学材料は、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム、窒化ガリウム、チタンとニオブと酸素の化合物、チタンとタンタルと酸素の化合物、または、窒化ケイ素である

請求項 2 1 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 2 8】

前記第 2 の光学材料は、液状の光学材料であり、

前記第 2 の光学材料を充填する工程は、

前記レジスト膜が除去された前記基材の前記第 1 の面の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 1 の面の凹部を光学材料からなる第 1 の層で密閉し、次に、前記第 2 の面の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 2 の面の凹部を光学材料からなる第 2 の層で密閉する工程を有する

請求項 2 1 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 2 9】

前記第 1 および第 2 の層は、一定または略一定の厚さの膜であり、

前記第 2 の光学材料は、光学油または液晶である

請求項 2 8 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 3 0】

前記第 1 および第 2 の層は、同一の光学材料からなり、

前記第 1 の層の厚さは、前記第 2 の層の厚さと同一または略同一である

請求項 2 9 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 3 1】

第 1 の光学材料からなる基材の凹部に、前記第 1 の光学材料とは屈折率が異なる第 2 の光学材料が充填された光学素子を製造する製造方法であって、

第 1 の凸部を備え、前記第 1 の凸部の周囲が平坦である第 2 の基材に対し、前記第 1 の凸部を埋没させる第 1 の光学材料の層からなる第 1 の基材を形成する工程と、

第 2 の凸部を備え、前記第 2 の凸部の周囲が平坦である第 4 の基材に対し、前記第 2 の凸部を埋没させる前記第 1 の光学材料の層からなる第 3 の基材を形成する工程と、

前記第 1 の基材の表面を平坦化して平坦面を形成し、当該平坦面を、第 3 の光学材料からなる第 5 の基材の対向する第 1 および第 2 の平坦面のうちで前記第 1 の平坦面に接合する工程と、

前記第 3 の基材の表面を平坦化して平坦面を形成し、当該平坦面を、前記第 5

の基材の前記第 2 の平坦面に接合する工程と、

前記第 5 の基材に接合された前記第 1 および第 3 の基材から、前記第 2 および第 4 の基材を除去し、前記第 1 および第 3 の基材のうち前記第 1 および第 2 の凸部の形状が写された凹部を露出させる工程と、

露出した前記第 1 および第 3 の基材の前記凹部に、前記第 2 の光学材料を充填する工程と

を有する

光学素子の製造方法。

【請求項 3 2】

前記第 1 および第 3 の基材の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を平坦化する工程をさらに有する

請求項 3 1 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 3 3】

前記第 1 および第 2 の凸部は、回転対称または略回転対称な形状を有し、前記平坦化する工程は、

前記第 1 の凸部の形状が写された前記第 1 の基材の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 1 の基材の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を研磨する工程と、

前記第 2 の凸部の形状が写された前記第 3 の基材の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 3 の基材の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を研磨する工程と

を有する

請求項 3 2 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 3 4】

前記第 1 の凸部をその対称軸に沿って切断した場合における前記第 1 の凸部の表面の形状は、円弧または略円弧であり、

前記第 2 の凸部をその対称軸に沿って切断した場合における前記第 2 の凸部の表面の形状は、円弧または略円弧である

請求項 3 3 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 3 5】

前記第 1 および第 3 の基材の前記凹部の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置する

請求項 3 4 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 3 6】

前記第 1 および第 3 の基材の前記凹部は、同一または略同一の大きさである

請求項 3 4 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 3 7】

前記第 1 および第 3 の光学材料は、同一の光学材料である

請求項 3 1 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 3 8】

前記第 2 の光学材料は、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム、窒化ガリウム、チタンとニオブと酸素の化合物、チタンとタンタルと酸素の化合物、または、窒化ケイ素である

請求項 3 1 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 3 9】

前記第 2 の光学材料は、液状の光学材料であり、

前記第 2 の光学材料を充填する工程は、

露出した前記第 1 の基材の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 1 の基材の前記凹部を光学材料からなる第 1 の層で密閉し、次に、前記第 3 の基材の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 3 の基材の前記凹部を光学材料からなる第 2 の層で密閉する工程を有する

請求項 3 1 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 4 0】

前記第 1 および第 2 の層は、一定または略一定の厚さの膜であり、

前記第 2 の光学材料は、光学油または液晶である

請求項 3 9 記載の光学素子の製造方法。

【請求項 4 1】

前記第 1 および第 2 の層は、同一の光学材料からなり、

前記第 1 の層の厚さは、前記第 2 の層の厚さと同一または略同一である
請求項 4 0 記載の光学素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光学素子とその製造方法とに関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

レンズを製造する場合、以下の第 1 ～第 3 の製造方法が知られている。

第 1 の製造方法は、所望のレンズ形状に加工された金型に光学材料を充填し、
モールド成形によりレンズを製造する方法である。

第 2 の製造方法は、反応性イオンエッチング（R I E : Reactive Ion Etching）
等のエッチングを利用し、フォトレジスト等をマスク（エッチングマスク）と
して用い、光学材料を所定形状にエッチングして当該光学材料からなるレンズを
製造する方法である。

第 3 の製造方法は、光学材料からなる基材をレンズ形状に機械研磨すること
によりレンズを製造する方法である。

【 0 0 0 3 】

【発明が解決しようとする課題】

従来の上記第 1 の製造方法、すなわち、モールド成形を用いる方法では、開口
数が多い小型のレンズを製造することが難しく、レンズ直径を 1 mm 以下にす
ることが困難である。

従来の上記第 2 の製造方法、すなわち、R I E 等のエッチング技術を用いる方
法では、光学材料が制限されるため、高屈折率の材料を用いることが困難であり
、開口数 N A が大きいレンズを実現することが困難である。

従来の第 3 の製造方法では、小型のレンズを製造することが困難である。

【 0 0 0 4 】

レンズの開口数を大きくすると、レンズを通過して生成される光スポットの大
きさを小さくすることが可能である。光ディスクの大容量化の観点から、光ヘッ

ドのレンズ（対物レンズ）の開口数 NA を大きくすることが望まれる。

また、レンズ等の光学素子は種々の光学装置に使用されており、光学装置の小型化の観点から、光学素子の小型化が望まれる。

【 0 0 0 5 】

開口数が高い光学素子を実現するには、光学材料の屈折率が高いことが有効である。

可視光の領域において高屈折率の光学材料は、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム（ガリウムリン）、窒化ガリウム、窒化ケイ素（窒化シリコン）等がある。

しかし、これらの材料を、従来技術では開口数が高い小型のレンズに加工することは困難である。

【 0 0 0 6 】

また、従来のレンズは、不定形をしているものが多い。このような不定形の複数のレンズをアライメントするには、3次元方向の高精度の位置合わせが必要であり、アライメントの作業の負担が大きい。

また、光ヘッドがスイングアームに搭載されたフライングヘッド（浮上ヘッド）を構成する場合、スライダとレンズとを別個に作成して高精度に貼り合わせるにより光ヘッドを作成可能であるが、この場合は貼合わせ作業の負担ひいては光ヘッドの作成の負担が大きい。

【 0 0 0 7 】

本発明の第1の目的は、小型の光学素子を生成可能な光学素子の製造方法を提供することにある、第2の目的は、小型で開口数が高い光学素子を生成可能な光学素子の製造方法を提供することにある、前記製造方法から生成可能な光学素子を提供することを第3の目的とし、当該光学素子を有する光学系を提供することを第4の目的とする。

【 0 0 0 8 】

【課題を解決するための手段】

本発明に係る光学素子は、第1の光学材料からなる基材と、前記第1の光学材料とは屈折率が異なる第2の光学材料とを有する光学素子であって、前記基材は

、互いに対向する第 1 および第 2 の面を有し、前記第 1 の面には第 1 の凹部が形成されていると共に、前記第 2 の面には第 2 の凹部が形成されており、前記第 1 および第 2 の凹部には、前記第 2 の光学材料が充填されている。

【 0 0 0 9 】

本発明に係る光学素子では、好適には、前記第 1 および第 2 の凹部は、回転対称または略回転対称な形状を有し、前記第 1 の面のうち前記第 1 の凹部の周囲には、第 1 の平坦部が形成されており、前記第 2 の面のうち前記第 2 の凹部の周囲には、第 2 の平坦部が形成されており、前記第 1 および第 2 の平坦部は、平行または略平行である。

【 0 0 1 0 】

本発明に係る光学素子では、より好適には、前記第 1 の凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面と前記第 1 の平坦部は、平行または略平行であり、前記第 2 の凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面と前記第 2 の平坦部は、平行または略平行である。

本発明に係る光学素子では、例えば、前記第 1 の凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面と前記第 1 の平坦部は、同一平面上または略同一平面上に位置し、前記第 2 の凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面と前記第 2 の平坦部は、同一平面上または略同一平面上に位置する構成としてもよい。

【 0 0 1 1 】

本発明に係る光学素子では、より好適には、前記第 1 の凹部をその対称軸に沿って切断した場合における前記第 1 の凹部の表面の形状は、円弧または略円弧であり、前記第 2 の凹部をその対称軸に沿って切断した場合における前記第 2 の凹部の表面の形状は、円弧または略円弧である。

【 0 0 1 2 】

本発明に係る光学素子では、より好適には、前記第 1 および第 2 の凹部の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置する。

本発明に係る光学素子では、例えば、前記第 1 および第 2 の凹部は、同一または略同一の大きさとしてもよい。

【 0 0 1 3 】

本発明に係る光学素子では、例えば、前記第 2 の光学材料は、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム、窒化ガリウム、チタンとニオブと酸素の化合物、チタンとタンタルと酸素の化合物、または、窒化ケイ素としてもよい。

【 0 0 1 4 】

本発明に係る光学素子では、好適には、前記第 2 の光学材料は、液状の光学材料であり、前記第 1 の面には、前記第 2 の光学材料が満たされた前記第 1 の凹部を密閉する光学材料からなる第 1 の層が形成されており、前記第 2 の面には、前記第 2 の光学材料が満たされた前記第 2 の凹部を密閉する光学材料からなる第 2 の層が形成されている。

【 0 0 1 5 】

本発明に係る光学素子では、例えば、前記第 1 および第 2 の層は、一定または略一定の厚さの膜であると共に、同一の光学材料からなり、前記第 1 の層の厚さは、前記第 2 の層の厚さと同一または略同一であり、前記第 2 の光学材料は、光学油または液晶である構成としてもよい。

【 0 0 1 6 】

本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法は、第 1 の光学材料からなる基材の凹部に、前記第 1 の光学材料とは屈折率が異なる第 2 の光学材料が充填された光学素子を製造する製造方法であって、空洞に対して突出した凸部が前記空洞の対向壁に形成された金型により、前記凸部の形状を写した凹部が、対向する第 1 および第 2 の面に形成された前記第 1 の光学材料からなる基材を、モールド成形により生成する工程と、前記モールド成形により生成された前記基材の前記第 1 および第 2 の面の前記凹部に、前記第 2 の光学材料を充填する工程とを有する。

【 0 0 1 7 】

本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法は、好適には、前記第 1 および第 2 の面の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を平坦化する工程をさらに有する。

【 0 0 1 8 】

本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法では、より好適には、前記対向壁の前記凸部は、回転対称または略回転対称な形状を有し、前記平坦化する工程は、前記対向壁のうちの一方の壁に形成された前記凸部の形状が写された前記第 1 の面の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 1 の面の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を研磨する工程と、前記対向壁のうちの他方の壁に形成された前記凸部の形状が写された前記第 2 の面の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 2 の面の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を研磨する工程とを有する。

【 0 0 1 9 】

本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法では、より好適には、前記対向壁の前記凸部を当該凸部の対称軸に沿って切断した場合における当該凸部の表面の形状は、円弧または略円弧である。

【 0 0 2 0 】

本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法では、例えば、前記対向壁の前記凸部の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置しており、前記第 1 および第 2 の面の前記凹部の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置する構成としてもよい。

本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 1 および第 2 の面の前記凹部は、同一または略同一の大きさとしてもよい。

【 0 0 2 1 】

本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 2 の光学材料は、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム、窒化ガリウム、チタンとニオブと酸素の化合物、チタンとタンタルと酸素の化合物、または、窒化ケイ素としてもよい。

【 0 0 2 2 】

本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法では、好適には、前記第 2 の光学材料は、液状の光学材料であり、前記第 2 の光学材料を充填する工程は、前記モール

ド成形により生成された前記基材の前記第 1 の面の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 1 の面の前記凹部を光学材料からなる第 1 の層で密閉し、次に、前記第 2 の面の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 2 の面の前記凹部を光学材料からなる第 2 の層で密閉する工程を有する。

【 0 0 2 3 】

本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 1 および第 2 の層は、一定または略一定の厚さの膜であり、前記第 2 の光学材料は、光学油または液晶である構成としてもよい。

本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 1 および第 2 の層は、同一の光学材料からなり、前記第 1 の層の厚さは、前記第 2 の層の厚さと同一または略同一である構成としてもよい。

【 0 0 2 4 】

本発明に係る第 2 の光学素子の製造方法は、第 1 の光学材料からなる基材の凹部に、前記第 1 の光学材料とは屈折率が異なる第 2 の光学材料が充填された光学素子を製造する製造方法であって、第 1 の光学材料からなる基材の、互いに対向する平坦または略平坦な第 1 および第 2 の面に、窓を有するレジスト膜を形成する工程と、前記窓に対応する凹部を、エッチングによって前記基材の前記第 1 および第 2 の面に形成する工程と、前記凹部が形成された前記基材から前記レジスト膜を除去する工程と、前記レジスト膜が除去された前記基材の前記第 1 および第 2 の面の前記凹部に、前記第 2 の光学材料を充填する工程とを有する。

【 0 0 2 5 】

本発明に係る第 2 の光学素子の製造方法は、好適には、前記第 1 および第 2 の面の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を平坦化する工程をさらに有する。

【 0 0 2 6 】

本発明に係る第 2 の光学素子の製造方法では、より好適には、前記窓は、円形または略円形であり、前記凹部は、回転対称または略回転対称な形状を有し、前記平坦化する工程は、前記第 1 の面の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 1 の面の前記凹部に充填された前記第 2

の光学材料の表面を研磨する工程と、前記第 2 の面の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 2 の面の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を研磨する工程とを有する。

【 0 0 2 7 】

本発明に係る第 2 の光学素子の製造方法では、より好適には、前記第 1 の面の前記凹部をその対称軸に沿って切断した場合における当該凹部の表面の形状は、円弧または略円弧であり、前記第 2 の面の前記凹部をその対称軸に沿って切断した場合における当該凹部の表面の形状は、円弧または略円弧である。

【 0 0 2 8 】

本発明に係る第 2 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 1 および第 2 の面の前記凹部の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置する構成としてもよい。

本発明に係る第 2 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 1 の面に形成された前記レジスト膜の窓は、前記第 2 の面に形成された前記レジスト膜の窓と同一または略同一の大きさであり、前記第 1 および第 2 の面の前記凹部は、同一または略同一の大きさである構成としてもよい。

【 0 0 2 9 】

本発明に係る第 2 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 2 の光学材料は、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム、窒化ガリウム、チタンとニオブと酸素の化合物、チタンとタンタルと酸素の化合物、または、窒化ケイ素としてもよい。

【 0 0 3 0 】

本発明に係る第 2 の光学素子の製造方法では、好適には、前記第 2 の光学材料は、液状の光学材料であり、前記第 2 の光学材料を充填する工程は、前記レジスト膜が除去された前記基材の前記第 1 の面の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 1 の面の凹部を光学材料からなる第 1 の層で密閉し、次に、前記第 2 の面の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 2 の面の凹部を光学材料からなる第 2 の層で密閉する工程を有する。

【 0 0 3 1 】

本発明に係る第 2 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 1 および第 2 の層は、一定または略一定の厚さの膜であり、前記第 2 の光学材料は、光学油または液晶である構成としてもよい。

本発明に係る第 2 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 1 および第 2 の層は、同一の光学材料からなり、前記第 1 の層の厚さは、前記第 2 の層の厚さと同一または略同一である構成としてもよい。

【 0 0 3 2 】

本発明に係る第 3 の光学素子の製造方法は、第 1 の光学材料からなる基材の凹部に、前記第 1 の光学材料とは屈折率が異なる第 2 の光学材料が充填された光学素子を製造する製造方法であって、第 1 の凸部を備え、前記第 1 の凸部の周囲が平坦である第 2 の基材に対し、前記第 1 の凸部を埋没させる第 1 の光学材料の層からなる第 1 の基材を形成する工程と、第 2 の凸部を備え、前記第 2 の凸部の周囲が平坦である第 4 の基材に対し、前記第 2 の凸部を埋没させる前記第 1 の光学材料の層からなる第 3 の基材を形成する工程と、前記第 1 の基材の表面を平坦化して平坦面を形成し、当該平坦面を、第 3 の光学材料からなる第 5 の基材の対向する第 1 および第 2 の平坦面のうちで前記第 1 の平坦面に接合する工程と、前記第 3 の基材の表面を平坦化して平坦面を形成し、当該平坦面を、前記第 5 の基材の前記第 2 の平坦面に接合する工程と、前記第 5 の基材に接合された前記第 1 および第 3 の基材から、前記第 2 および第 4 の基材を除去し、前記第 1 および第 3 の基材のうち前記第 1 および第 2 の凸部の形状が写された凹部を露出させる工程と、露出した前記第 1 および第 3 の基材の前記凹部に、前記第 2 の光学材料を充填する工程とを有する。

【 0 0 3 3 】

本発明に係る第 3 の光学素子の製造方法は、好適には、前記第 1 および第 3 の基材の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を平坦化する工程をさらに有する。

【 0 0 3 4 】

本発明に係る第 4 の光学素子の製造方法では、より好適には、前記第 1 および

第 2 の凸部は、回転対称または略回転対称な形状を有し、前記平坦化する工程は、前記第 1 の凸部の形状が写された前記第 1 の基材の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 1 の基材の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を研磨する工程と、前記第 2 の凸部の形状が写された前記第 3 の基材の前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 3 の基材の前記凹部に充填された前記第 2 の光学材料の表面を研磨する工程とを有する。

【 0 0 3 5 】

本発明に係る第 3 の光学素子の製造方法では、より好適には、前記第 1 の凸部をその対称軸に沿って切断した場合における前記第 1 の凸部の表面の形状は、円弧または略円弧であり、前記第 2 の凸部をその対称軸に沿って切断した場合における前記第 2 の凸部の表面の形状は、円弧または略円弧である。

【 0 0 3 6 】

本発明に係る第 3 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 1 および第 3 の基材の前記凹部の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置する構成としてもよい。

本発明に係る第 3 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 1 および第 3 の基材の前記凹部は、同一または略同一の大きさとしてもよい。

【 0 0 3 7 】

本発明に係る第 3 の光学素子の製造方法では、好適には、前記第 1 および第 3 の光学材料は、同一の光学材料である。

【 0 0 3 8 】

本発明に係る第 3 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 2 の光学材料は、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム、窒化ガリウム、チタンとニオブと酸素の化合物、チタンとタンタルと酸素の化合物、または、窒化ケイ素としてもよい。

【 0 0 3 9 】

本発明に係る第 3 の光学素子の製造方法では、好適には、前記第 2 の光学材料は、液状の光学材料であり、前記第 2 の光学材料を充填する工程は、露出した前

記第 1 の基材の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 1 の基材の前記凹部を光学材料からなる第 1 の層で密閉し、次に、前記第 3 の基材の前記凹部に前記第 2 の光学材料を満たして当該第 3 の基材の前記凹部を光学材料からなる第 2 の層で密閉する工程を有する。

【 0 0 4 0 】

本発明に係る第 3 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 1 および第 2 の層は、一定または略一定の厚さの膜であり、前記第 2 の光学材料は、光学油または液晶である構成としてもよい。

本発明に係る第 3 の光学素子の製造方法では、例えば、前記第 1 および第 2 の層は、同一の光学材料からなり、前記第 1 の層の厚さは、前記第 2 の層の厚さと同一または略同一である構成としてもよい。

【 0 0 4 1 】

上記した本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法において、金型は、空洞に対して突出した凸部が、空洞の対向壁に形成されている。この金型により基材をモールド成形することで、凸部の形状を写した凹部を基材の対向面に形成することができる。

第 1 の光学材料からなる基材の凹部に、第 2 の光学材料を充填することで、屈折率の違いにより凹部の表面で光を屈折させることができる。金型の凸部を小型にすることで、基材の凹部を小型にすることができ、小型の光学素子を生成可能である。

また、光学材料を充填した凹部を基材の対向面に設けることで、光学材料を充填した凹部を基材の 1 つの面にのみ設ける場合に比べ、光学素子の開口数を大きくすることが可能である。

また、第 2 の光学材料として、屈折率が高い材料、例えば、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム、窒化ガリウム、チタンとニオブと酸素の化合物、チタンとタンタルと酸素の化合物、または、窒化ケイ素を用いることで、開口数の大きい光学素子を生成可能である。

【 0 0 4 2 】

上記した本発明に係る第 2 の光学素子の製造方法において、第 1 の光学材料が

らなる基材の対向面に、窓を有するレジスト膜を形成することで、窓に対応する凹部をエッチングにより形成することができる。

凹部が形成された基材からレジスト膜を除去し、凹部に第2の光学材料を充填することで、屈折率の違いによって凹部の表面で光を屈折させることができる。窓を小型にすることで、基材の凹部を小型にすることができ、小型の光学素子を生成可能である。

また、光学材料を充填した凹部を基材の対向面に設けることで、光学材料を充填した凹部を基材の1つの面にのみ設ける場合に比べ、光学素子の開口数を大きくすることが可能である。

また、第2の光学材料として、屈折率が大きい材料、例えば、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム、窒化ガリウム、チタンとニオブと酸素の化合物、チタンとタンタルと酸素の化合物、または、窒化ケイ素を用いることで、開口数の大きい光学素子を生成可能である。

【 0 0 4 3 】

上記した本発明に係る第3の光学素子の製造方法において、第2および第4の基材は、凸部を備え、当該凸部の周囲が平坦である。第2の基材に対し、凸部を埋没させる第1の光学材料の層からなる第1の基材を形成し、第4の基材に対し、凸部を埋没させる第1の光学材料の層からなる第3の基材を形成することで、凸部の形状を写した凹部を第1および第3の基材に形成することができる。

第1および第3の基材の表面を平坦化して平坦面を形成し、当該平坦面を、第3の光学材料からなる第5の基材の対向面に接合し、第5の基材に接合された第1および第3の基材から、第2および第4の基材を除去することで、第1および第3の基材のうち凸部の形状を写した凹部を露出させることができる。

第1および第3の基材の凹部に、第2の光学材料を充填することで、屈折率の違いによって凹部の表面で光を屈折させることができる。第2および第4の基材の凸部を小型にすることで、第1および第3の基材の凹部を小型にすることができ、小型の光学素子を生成可能である。

また、第5の基材に接合された第1および第3の基材は、光学材料を充填した凹部を有するので、第1または第3の基材の一方のみを第5の基材に接合した場

合に比べ、光学素子の開口数を大きくすることが可能である。

また、第2の光学材料として、屈折率が高い材料、例えば、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ニオブ、リン化ガリウム、窒化ガリウム、チタンとニオブと酸素の化合物、チタンとタンタルと酸素の化合物、または、窒化ケイ素を用いることで、開口数の大きい光学素子を生成可能である。

【0044】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して説明する。

【0045】

光学素子

図1は、本発明に係る光学素子の実施の形態を示す概略的な構成図である。

この光学素子100は、直方体または略直方体の形状を有する。光学素子100は、基材（基体）101とレンズ102、103とを有する。

光学素子100の基材101およびレンズ102、103は屈折率が異なり、基材101およびレンズ102、103の境界で光を屈折させることができる。例えば、レンズ103の平坦面に光を入射させた場合に、レンズ102の平坦面から出射する光を、収束（集束）または発散させることができ、または平行光にすることができる。

【0046】

基材101は、基材101の下面100Bに回転対称または略回転対称な凹部101Bを有する。凹部101Bをその対称軸に沿って切断した場合における凹部101Bの表面の形状は、好適には円弧または略円弧とする。

凹部101Bは、基材101とは屈折率の異なる光学材料で充填されており、当該光学材料で充填された凹部101Bによりレンズ102が構成されている。

また、レンズ102の凸状の曲面は、基材101の凹部101Bの表面に密着している。

【0047】

レンズ102の下面は、平坦または略平坦であり、光学素子100の上面（または基材101の上面100U）と平行または略平行になっている。また、レン

ズ102の下面および基材101の下面100Bの平坦部101Cは、平行または略平行であり、図1では、同一平面上に位置している。

【0048】

基材101は、基材101の上面100Uに回転対称または略回転対称な凹部101Dを有する。凹部101Dをその対称軸に沿って切断した場合における凹部101Dの表面の形状は、好適には円弧または略円弧とする。

凹部101Dは、基材101とは屈折率の異なる光学材料で充填されており、当該光学材料で充填された凹部101Dによりレンズ103が構成されている。

また、レンズ103の凸状の曲面は、基材101の凹部101Dの表面に密着している。

【0049】

レンズ103の上面は、平坦または略平坦であり、光学素子100の下面（または基材101の下面100B）と平行または略平行になっている。また、レンズ103の上面および基材101の上面100Uの平坦部101Eは、平行または略平行であり、図1では、同一平面上に位置している。

【0050】

基材101の凹部101B、101Dの対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置する。これに対応して、レンズ102、103の光軸は、同一直線上または略同一直線上に位置している。レンズ102、103は、好適には、同一または略同一の大きさとする。

【0051】

基材101の材料を例えば石英とし、レンズ102、103の材料を例えば窒化ケイ素（窒化シリコン）とした場合は、レンズ102、103は基材101よりも屈折率が大きいため、凸レンズの機能をレンズ102、103に持たせることができる。

逆に、基材101の材料を例えば窒化ケイ素とし、レンズ102、103の材料を例えば石英とした場合は、レンズ102、103は基材101よりも屈折率が小さいので、凹レンズの機能をレンズ102、103に持たせることができる。

【 0 0 5 2 】

光学素子の製造方法の第 1 の実施の形態

図 2 および図 3 は、光学素子の製造方法の第 1 の実施の形態を示す概略的な説明図である。この製造方法により、図 1 の光学素子 1 0 0 と同一構造または略同一構造の光学素子を得ることが可能である。

【 0 0 5 3 】

図 2 (A) は、金型 3 を示している。この金型 3 には、液状または流動体状の光学材料 6 L が通過する通路 4 と、空洞 (キャビティ) 3 C とが形成されている。また、金型 3 の空洞 3 C では下側の内壁と上側の内壁が対向しており、下側の内壁には、空洞 3 C に対して突起した凸部 5 が形成されており、上側の内壁には、空洞 3 C に対して突起した凸部 5 A が形成されており、凸部 5, 5 A の周囲は平坦になっている。

【 0 0 5 4 】

凸部 5 は、図 1 の光学素子 1 0 0 のレンズ 1 0 2 の形状と同一または略同一であり、回転対称または略回転対称な形状を有する。

また、凸部 5 A は、図 1 の光学素子 1 0 0 のレンズ 1 0 3 の形状と同一または略同一であり、回転対称または略回転対称な形状を有する。

凸部 5, 5 A の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置する。

【 0 0 5 5 】

図 2 (B) では、金型 3 の通路 4 から光学材料 6 L を空洞 3 C に注入し、光学材料 6 を空洞 3 C に充填する。注入する光学材料 6 L は、例えば熔融石英、ガラス、プラスチック、合成樹脂等とする。

【 0 0 5 6 】

図 2 (C) では、液状の光学材料 6 L を固体状の光学材料 6 M に硬化させ、光学材料 6 M からなる基材 6 を金型 3 から取り出す。

金型 3 から取り出された基材 6 の下面には、凸部 5 の形状が転写されて凹部 6 B が形成されている。凹部 6 B は、対称または略対称な形状を有する。基材 6 の凹部 6 B の周囲は、平坦になっている。

また、基材 6 の上面には、凸部 5 A の形状が転写されて凹部 6 U が形成されて

いる。凹部 6 U は、対称または略対称な形状を有する。基材 6 の凹部 6 U の周囲は、平坦になっている。

基材 6 の凹部 6 B, 6 U の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置している。

【 0 0 5 7 】

図 3 (D) では、基材 6 の下面の凹部 6 B に、光学材料 7 M を充填する。光学材料 7 M は、光学材料 6 M とは異なる屈折率を有し、好適には光学材料 6 M よりも大きい屈折率を有し、一例として窒化ケイ素とする。

例えば、基材 6 の下面に、スパッタリング、蒸着またはイオンプレーティングにより光学材料 7 M の層 7 を形成することで、基材 6 の凹部 6 B に光学材料 7 M を充填する。この場合、凹部 6 B に対応する凹部 7 B が、層 7 に形成される。

【 0 0 5 8 】

また、基材 6 の上面の凹部 6 U に、光学材料 7 1 M を充填する。この光学材料 7 1 M は、光学材料 7 M と同一の材料とすることが好ましい。

例えば、基材 6 の上面に、スパッタリング、蒸着またはイオンプレーティングにより光学材料 7 1 M の層 7 1 を形成することで、基材 6 の凹部 6 U に光学材料 7 1 M を充填する。この場合、凹部 6 U に対応する凹部 7 1 U が、層 7 1 に形成される。

なお、光学材料 7 M, 7 1 M を同一材料とし、基材 6 の上下面に、蒸着により光学材料 7 M の層 7, 7 1 を形成することで、基材 6 の凹部 6 B, 6 U に対して光学材料 7 M を充填してもよい。

【 0 0 5 9 】

図 3 (E) では、層 7 の下面（底面）を平坦化する。例えば、層 7 の下面の凹部 7 B が無くなるように研磨する。好ましくは、基材 6 の凹部 6 B の対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層 7 の下面を研磨する。または、基材 6 の凹部 6 B の周囲の平坦部（または平坦面）と層 7 の下面とが平行もしくは略平行になるように層 7 を研磨する。

【 0 0 6 0 】

また、層 7 1 の上面を平坦化する。例えば、層 7 1 の上面の凹部 7 1 U が無く

なるように研磨する。好ましくは、基材 6 の凹部 6 U の対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層 7 1 の上面を研磨する。または、基材 6 の凹部 6 U の周囲の平坦部（または平坦面）と層 7 1 の上面とが平行もしくは略平行になるように層 7 1 を研磨する。

【 0 0 6 1 】

基材 6 の凹部 6 B，6 U の周囲の平坦部が露出するように層 7，7 1 を研磨することで、図 1 の光学素子 1 0 0 と同じ構造の光学素子を得ることが可能である。

なお、図 3（E）の基材 6 および凹部 6 B，6 U は、図 1 の光学素子 1 0 0 の基材 1 0 1 および凹部 1 0 1 B，1 0 1 D に各々対応している。

【 0 0 6 2 】

金型 3 の上下の内壁は、空洞 3 C に対して突起した凸部 5，5 A を有するので、空洞 3 C に対して窪んだ形状の凹部を形成してモールド成形により凸レンズを作成する場合に比べ、加工精度を向上することができる。このように、金型 3 を使用することで、モールド成形の凸レンズよりも加工精度の高い小型の凸レンズを作成可能である。

【 0 0 6 3 】

なお、図 2（A），（B）に示す金型に代えて、上金型と下金型を用いて基材 6 のモールド成形を行ってもよい。下金型の下側の内壁には、凸部が形成されており、この凸部の周囲は平坦になっている。この凸部は、図 2（A），（B）の凸部 5 と同一である。上金型の下側の内壁には、凸部が形成されており、この凸部の周囲は平坦になっている。この凸部は、図 2（A），（B）の凸部 5 A と同一である。

【 0 0 6 4 】

先ず、下金型および上金型の間の空洞に、光学材料（例えばガラス材料）を注入し、ガラス材料、下金型および上金型を所定の温度に同時に加熱することで、ガラス材料を軟化させる。そして、軟化したガラス材料を上金型でプレスする。この場合、上金型および下金型の内壁の凸部の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置する。

【 0 0 6 5 】

次に、ガラス材料、下金型および上金型を冷却してガラス材料を硬化させて基材 6 を金型から取り出す。この金型から取り出された基材 6 の下面には、凸部 5 の形状が転写されて凹部 6 B が形成され、基材 6 の上面には、凸部 5 A の形状が転写されて凹部 6 U が形成される。

このようにして、図 2 (C) に示す基材 6 を得ることも可能である。

【 0 0 6 6 】

光学素子の製造方法の第 2 の実施の形態

図 4 および図 5 は、光学素子の製造方法の第 2 の実施の形態を示す概略的な説明図である。この製造方法により、図 1 の光学素子 1 0 0 と同一構成または略同一構成の光学素子を得ることが可能である。

【 0 0 6 7 】

図 4 (A) では、基材の一例であるシリコン基板 8 の平坦面に、レジスト 9 を形成する。レジスト 9 の底面の大きさは、図 1 中のレンズ 1 0 2, 1 0 3 の平坦面の大きさと同一または略同一とする。

【 0 0 6 8 】

図 4 (B) では、レジスト 9 をマスクとし、エッチングによりシリコン基板 8 の表面に凸部 8 U を形成する。凸部 8 U の形状は、レンズ 1 0 2, 1 0 3 の形状と同一であり、回転対称または略回転対称な形状である。エッチングとしては、例えば、イオンミリング法、R I E 法などを用いる。

【 0 0 6 9 】

図 4 (C) では、凸部 8 U が形成されたシリコン基板 8 の表面に、凸部 8 U が埋没するように光学材料 1 0 M を積層させ、光学材料 1 0 M の層 1 0 からなる基材を形成する。層 1 0 は、例えば、スパッタリング法、蒸着法、イオンプレーティング法などを用いて形成してもよい。

シリコン基板 8 上に層 1 0 が形成されると、凸部 8 U に対応する凸部 1 0 U が、層 1 0 の上面に形成される。

【 0 0 7 0 】

図 4 (D) では、層 1 0 の上面を平坦化する。例えば、層 1 0 の上面の凸部 1

0 Uが無くなるように研磨して平坦面10 Sを形成する。好ましくは、シリコン基板8の凸部8 Uの対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層10の上面を研磨する。または、シリコン基板8の凸部8 Uの周囲の平坦部と層10の上面とが平行または略平行になるように層10を研磨する。

このようにして、図4 (D) に示すシリコン基材8および層10を複数生成する。

【0071】

図4 (E) では、対向する平坦面が形成された基材11の下側の平坦面に、層10₁の平坦面10 S₁を接合する。また、基材11の上側の平坦面に、層10₂の平坦面10 S₂を接合する。凸部8 U₁、8 U₂は、同一直線上または略同一直線上に位置している。

なお、シリコン基板8₁、8₂、凸部8 U₁、8 U₂、層10₁、10₂、および平坦面10 S₁、10 S₂は、図4 (D) の対応するシリコン基板8、凸部8 U、層10、および表面10 Sと同じ構成である。

【0072】

また、基材11の上下の平坦面と層10₁、10₂の平坦面10 S₁、10 S₂との接合方法としては、例えば、透明な接着剤により接着してもよく、陽極接合により接合してもよい。基材11の光学材料11 Mは、好ましくは、光学材料10 Mと同じ材料とする。

【0073】

図5 (F) では、図4 (E) の層10₁の下面に接合されていたシリコン基板8₁を除去し、層10₁の下面を露出させる。また、層10₂の上面に接合されていたシリコン基板8₂を除去し、層10₂の上面を露出させる。

なお、シリコン基板8₁、8₂は、例えば水酸化カリウム水溶液により溶解させて除去してもよい。

【0074】

層10₁の下面には、シリコン基板8₁の凸部8 U₁の形状が転写されており、凸部8 U₁に対応する凹部10 B₁が形成されている。凹部10 B₁は、対称または略対称な形状を有する。

また、層 10_2 の上面には、シリコン基板 8_2 の凸部 $8U_2$ の形状が転写されており、凸部 $8U_2$ に対応する凹部 $10B_2$ が形成されている。凹部 $10B_2$ は、対称または略対称な形状を有する。

凹部 $10B_1$ 、 $10B_2$ の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置している。

【0075】

図5 (G) では、層 10_1 の下面の凹部 $10B_1$ に光学材料 $7M$ を充填する。光学材料 $7M$ は、光学材料 $10M$ とは異なる屈折率を有し、好適には光学材料 $10M$ よりも大きい屈折率を有し、一例として窒化ケイ素とする。

例えば、層 10_1 の下面に、スパッタリング、蒸着またはイオンプレーティングにより光学材料 $7M$ の層 7 を形成することで、層 10_1 の凹部 $10B_1$ に光学材料 $7M$ を充填する。この場合、凹部 $10B_1$ に対応する凹部 $7B$ が、層 7 に形成される。

【0076】

また、層 10_2 の上面の凹部 $10B_2$ に光学材料 $71M$ を充填する。光学材料 $71M$ は、好適には光学材料 $7M$ と同じ材料とする。

例えば、層 10_2 の上面に、スパッタリング、蒸着またはイオンプレーティングにより光学材料 $71M$ の層 71 を形成することで、層 10_2 の凹部 $10B_2$ に光学材料 $71M$ を充填する。この場合、凹部 $10B_2$ に対応する凹部 $71U$ が、層 71 に形成される。

なお、光学材料 $7M$ 、 $71M$ を同一材料とし、基材 10_1 の下面および基材 10_2 の上面に、蒸着により光学材料 $7M$ の層 7 、 71 を形成することで、基材 10_1 、 10_2 の凹部 $10B_1$ 、 $10B_2$ に対して光学材料 $7M$ を充填してもよい。

【0077】

図5 (H) では、層 7 の下面（底面）を平坦化する。例えば、層 7 の下面の凹部 $7B$ が無くなるように研磨する。好ましくは、層 10_1 の凹部 $10B_1$ の対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層 7 の下面を研磨する。または、層 10_1 の凹部 $10B_1$ の周囲の平坦部（または平坦面）と層 7 の下面とが平行

もしくは略平行になるように層 7 を研磨する。

【0078】

また、層 71 の上面を平坦化する。例えば、層 71 の上面の凹部 71U が無くなるように研磨する。好ましくは、層 10₂ の凹部 10B₂ の対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層 71 の上面を研磨する。または、層 10₂ の凹部 10B₂ の周囲の平坦部（または平坦面）と層 71 の上面とが平行もしくは略平行になるように層 71 を研磨する。

【0079】

層 10₁、10₂ の凹部 10B₁、10B₂ の周囲の平坦部が露出するように層 7、71 を研磨することで、図 1 の光学素子 100 と同一構造または略同一構造の光学素子を得ることが可能である。

なお、図 5 (H) の層 10₁、10₂ が接合された基材 11、および凹部 10B₁、10B₂ は、図 1 の光学素子 100 の基材 101、および凹部 101B、101D に各々対応している。

【0080】

光学素子の製造方法の第 3 の実施の形態

図 6 および図 7 は、光学素子の製造方法の第 3 の実施の形態を示す概略的な説明図である。この製造方法により、図 1 の光学素子 100 と同一構成または略同一構成の光学素子を得ることが可能である。

【0081】

図 6 (A) では、基材の一例であるシリコン基板 18 の平坦面にレジスト 19 を形成する。レジスト 19 の底面の大きさは、図 1 中のレンズ 102、103 の平坦面の大きさと同一または略同一とする。

【0082】

図 6 (B) では、レジスト 19 が形成されたシリコン基板 18 の表面に、レジスト 19 が埋没するように光学材料 20M を積層させ、光学材料 20M の層 20 からなる基材を形成する。光学材料 20M の層 20 は、例えば、スパッタリング法、蒸着法、イオンプレーティング法などを用いて形成してもよい。光学材料 20M は、例えば、酸化アルミニウムとしてもよい。

シリコン基板 18 上に層 20 が形成されると、レジスト 19 に応じた凸部 20 U が、層 20 の表面に形成される。

【 0 0 8 3 】

図 6 (C) では、層 20 の上面を平坦化する。例えば、層 20 の上面の凸部 20 U が無くなるように研磨して平坦面 20 S を形成する。好ましくは、シリコン基板 18 上のレジスト 19 の対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層 20 の上面を研磨する。または、シリコン基板 18 上のレジスト 19 の周囲の平坦部（または平坦面）と層 20 の上面とが平行もしくは略平行になるように層 20 を研磨する。

このようにして、図 6 (C) に示すシリコン基材 18 および層 20 を複数生成する。

【 0 0 8 4 】

図 6 (D) では、対向する平坦面を有する基材 21 の下側の平坦面に、層 20₁ の平坦面 20 S₁ を接合する。また、基材 21 の上側の平坦面に、層 20₂ の平坦面 20 S₂ を接合する。レジスト 19₁、19₂ の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置している。

なお、シリコン基板 18₁、18₂、レジスト 19₁、19₂、層 20₁、20₂、および平坦面 20 S₁、20 S₂ は、図 6 (C) の対応するシリコン基板 18、レジスト 19、層 20、および平坦面 20 S と同じ構成である。

【 0 0 8 5 】

また、基材 21 の上下の平坦面と層 20₁、20₂ の平坦面 20 S₁、20 S₂ との接合方法としては、例えば、透明な接着剤により接着してもよく、陽極接合により接合してもよい。基材 21 の光学材料 21 M は、好ましくは、光学材料 20 M と同一の材料とする。

【 0 0 8 6 】

図 7 (E) では、図 6 (D) の層 20₁ の下面に接合されていたシリコン基板 18₁ およびレジスト 19₁ を除去し、層 20₁ の下面を露出させる。また、層 20₂ の上面に接合されていたシリコン基板 18₂ およびレジスト 19₂ を除去し、層 20₂ の上面を露出させる。

なお、シリコン基板 18_1 , 18_2 は、例えば水酸化カリウム水溶液により溶解させて除去してもよい。レジスト 19_1 , 19_2 は、例えばレジスト用の剥離液または有機溶剤（例えばアセトン）等により溶解させて除去してもよい。

【0087】

層 20_1 の下面には、レジスト 19_1 の形状が転写されており、レジスト 19_1 の形状に対応する凹部 $20B_1$ が形成されている。凹部 $20B_1$ は、対称または略対称な形状を有する。

また、層 20_2 の上面には、レジスト 19_2 の形状が転写されており、レジスト 19_2 の形状に対応する凹部 $20B_2$ が形成されている。凹部 $20B_2$ は、対称または略対称な形状を有する。

凹部 $20B_1$, $20B_2$ の対称軸は、同一直線上または略同一直線上に位置している。

【0088】

図7(F)では、層 20_1 の下面の凹部 $20B_1$ に光学材料7Mを充填する。光学材料7Mは、光学材料20Mとは異なる屈折率を有し、好適には光学材料20Mよりも大きい屈折率を有し、一例として窒化ケイ素とする。

例えば、層 20_1 の下面に、スパッタリング、蒸着またはイオンプレーティングにより光学材料7Mの層7を形成することで、層 20_1 の凹部 $20B_1$ に光学材料7Mを充填する。この場合、凹部 $20B_1$ に対応する凹部7Bが、層7に形成される。

【0089】

また、層 20_2 の上面の凹部 $20B_2$ に光学材料71Mを充填する。光学材料71Mは、好適には光学材料7Mと同じ材料とする。

例えば、層 20_2 の上面に、スパッタリング、蒸着またはイオンプレーティングにより光学材料71Mの層71を形成することで、層 20_2 の凹部 $20B_2$ に光学材料71Mを充填する。この場合、凹部 $20B_2$ に対応する凹部71Uが、層7に形成される。

なお、光学材料7M, 71Mを同一材料とし、基材 20_1 の下面および基材 20_2 の上面に、蒸着により光学材料7Mの層7, 71を形成することで、基材2

0_1 , 20_2 の凹部 $20B_1$, $20B_2$ に対して光学材料 7M を充填してもよい。

【0090】

図 7 (G) では、層 7 の下面 (底面) を平坦化する。例えば、層 7 の下面の凹部 7B が無くなるように研磨する。好ましくは、層 20_1 の凹部 $20B_1$ の対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層 7 の上面を研磨する。または、層 20_1 の凹部 $20B_1$ の周囲の平坦部 (または平坦面) と層 7 の上面とが平行もしくは略平行になるように層 7 を研磨する。

【0091】

また、層 71 の上面を平坦化する。例えば、層 71 の上面の凹部 71U が無くなるように研磨する。好ましくは、層 20_2 の凹部 $20B_2$ の対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層 71 の上面を研磨する。または、層 20_2 の凹部 $20B_2$ の周囲の平坦部 (または平坦面) と層 71 の底面とが平行もしくは略平行になるように層 71 を研磨する。

【0092】

層 20_1 , 20_2 の凹部 $20B_1$, $20B_2$ の周囲の平坦部が露出するように層 7 を研磨することで、図 1 の光学素子 100 と同一構造または略同一構造の光学素子を得ることが可能である。

なお、図 7 (G) の層 20_1 , 20_2 が接合された基材 21、および凹部 $20B_1$, $20B_2$ は、図 1 の光学素子 100 の基材 101、および凹部 101B、101D に各々対応している。

【0093】

光学素子の製造方法の第 4 の実施の形態

図 8 および図 9 は、光学素子の製造方法の第 4 の実施の形態を示す概略的な説明図である。この製造方法により、図 1 の光学素子 100 と同一構成または略同一構成の光学素子を得ることが可能である。

【0094】

図 8 (A) では、光学材料 31M からなる基材 31 の対向する平坦面のうち一方の平坦面に、レジスト膜 29 を形成する。また、基材 31 の他方の平坦面に、

レジスト膜 3 9 を形成する。光学材料 3 1 M は、例えば石英とする。

基材 3 1 の一方の平坦面上のレジスト膜 2 9 には、円形または略円形の窓 2 9 H が形成されており、基材 3 1 の他方の平坦面上のレジスト膜 3 9 には、円形または略円形の窓 3 9 H が形成されている。窓 2 9 H, 3 9 H は同一または略同一の大きさであり、窓 2 9 H, 3 9 H の中心軸は、同一直線上または略同一直線上に位置している。図示のように、窓 2 9 H, 3 9 H は、レジスト膜 2 9, 3 9 の孔および／または開口部を構成している。

【 0 0 9 5 】

図 8 (B) では、レジスト膜 2 9, 3 9 が形成された基材 3 1 をエッチング液 3 2 に所定時間浸す。エッチング液 3 2 は、例えば石英を腐食するフッ酸液等により構成する。

基材 3 1 をエッチング液 3 2 に所定時間浸すことで、レジスト膜 2 9, 3 9 の窓 2 9 H, 3 9 H から基材 3 1 が徐々に腐食され、基材 3 1 の上下面には窓 2 9 に対応する凹部 3 1 U と、窓 3 9 に対応する凹部 3 1 B とが形成される。凹部 3 1 B, 3 1 U の大きさは、図 1 中のレンズ 1 0 2, 1 0 3 の大きさと同一または略同一とする。凹部 3 1 B, 3 1 U は対称または略対称な形状を有し、凹部 3 1 B, 3 1 U の対称軸は同一直線上または略同一直線上に位置する。

【 0 0 9 6 】

図 9 (C) では、基材 3 1 をエッチング液 3 2 から取り出し、レジスト膜 2 9, 3 9 を除去する。レジスト膜 2 9, 3 9 は、レジスト用の剥離液または有機溶剤（例えばアセトン）等により溶解して除去してもよい。

【 0 0 9 7 】

図 9 (D) では、基材 3 1 の下面の凹部 3 1 B に光学材料 7 M を充填する。光学材料 7 M は、光学材料 3 1 M とは異なる屈折率を有し、好適には光学材料 3 1 M よりも大きい屈折率を有し、一例として窒化ケイ素とする。

例えば、基材 3 1 の下面に、スパッタリング、蒸着またはイオンプレーティングにより光学材料 7 M の層 7 を形成することで、基材 3 1 の下面の凹部 3 1 B に光学材料 7 M を充填する。この場合、凹部 3 1 B に対応する凹部 7 B が、層 7 に形成される。

【 0 0 9 8 】

また、基材 3 1 の上面の凹部 3 1 U に光学材料 7 1 M を充填する。光学材料 7 1 M は、好適には光学材料 7 M と同じ材料とする。

例えば、基材 3 1 の上面に、スパッタリング、蒸着またはイオンプレーティングにより光学材料 7 1 M の層 7 1 を形成することで、基材 3 1 の上面の凹部 3 1 U に光学材料 7 1 M を充填する。この場合、凹部 3 1 U に対応する凹部 7 1 U が、層 7 1 に形成される。

なお、光学材料 7 M, 7 1 M を同一の材料とし、基材 3 1 の上下面に、蒸着により光学材料 7 M の層 7, 7 1 を形成することで、基材 3 1 の凹部 3 1 B, 3 1 U に対して光学材料 7 M を充填してもよい。

【 0 0 9 9 】

図 9 (E) では、層 7 の下面を平坦化する。例えば、層 7 の下面の凹部 7 B が無くなるように研磨する。好ましくは、基材 3 1 の凹部 3 1 B の対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層 7 の下面を研磨する。または、基材 3 1 の凹部 3 1 B の周囲の平坦部（または平坦面）と層 7 の下面とが平行もしくは略平行になるように層 7 を研磨する。

【 0 1 0 0 】

また、層 7 1 の上面を平坦化する。例えば、層 7 1 の上面の凹部 7 1 U が無くなるように研磨する。好ましくは、基材 3 1 の凹部 3 1 U の対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層 7 1 の上面を研磨する。または、基材 3 1 の凹部 3 1 U の周囲の平坦部（または平坦面）と層 7 1 の上面とが平行もしくは略平行になるように層 7 1 を研磨する。

【 0 1 0 1 】

基材 3 1 の凹部 3 1 B, 3 1 U の周囲の平坦部が露出するように層 7, 1 7 を研磨することで、図 1 の光学素子 1 0 0 と同一構造または略同一構造の光学素子を得ることが可能である。

なお、図 9 (E) の基材 3 1 および凹部 3 1 B, 3 1 U は、図 1 の光学素子 1 0 0 の基材 1 0 1 および凹部 1 0 1 B, 1 0 1 D に各々対応している。

【 0 1 0 2 】

光学素子の製造方法の第 5 の実施の形態

図 1 0 は、光学素子の製造方法の第 5 の実施の形態を示す概略的な説明図である。この製造方法により、図 1 の光学素子 1 0 0 と同一構成または略同一構成の光学素子を得ることが可能である。

【 0 1 0 3 】

図 1 0 (A) の基材 4 1 は、対向面のうち一方の面に凹部 4 1 B を有し、他方の面に 4 1 U を有する。凹部 4 1 B、4 1 U は、回転対称または略回転対称な形状を有し、凹部 4 1 B、4 1 U の対称軸は同一直線上または略同一直線上に位置している。基材 4 1 のうち凹部 4 1 B、4 1 U の周囲は、平坦になっている。基材 4 1 は、光学材料 4 1 M からなる。

凹部 4 1 B、4 1 U の大きさは、図 1 中のレンズ 1 0 2、1 0 3 の大きさと同一または略同一である。

この基材 4 1 は、例えば、図 2 (C) 中の基材 6、図 5 (F) 中の層 1 0₁、1 0₂ が接合された基材 1 1、図 7 (E) 中の層 2 0₁、2 0₂ が接合された基材 2 1、または、図 9 (C) 中の基材 3 1 を用いる。

【 0 1 0 4 】

図 1 0 (B) では、基材 4 1 の下面の凹部 4 1 B に、光学材料 4 1 M とは屈折率が異なる光学材料 2 7 M を充填する。

一例として、光学材料 4 1 M が石英ではない場合、光学材料 2 7 M としてゲル化された石英を用い、基材 4 1 の下面に塗布することで、光学材料 2 7 M の層 2 7 を形成し、基材 4 1 の下面の凹部 4 1 B に光学材料 2 7 M を充填する。

【 0 1 0 5 】

また、基材 4 1 の上面の凹部 4 1 U に、光学材料 3 7 M を充填する。光学材料 3 7 M を基材 4 1 の上面に塗布することで、光学材料 3 7 M の層 3 7 を形成し、基材 4 1 の上面の凹部 4 1 U に光学材料 3 7 M を充填する。光学材料 3 7 M は、光学材料 2 7 M と同一の材料とする。

そして、凹部 4 1 B、4 1 U に光学材料 2 7 M、3 7 M が充填された基材 4 1 を加熱し、光学材料 2 7 M、3 7 M を硬化させる。

【0106】

図10(C)では、硬化した層27の表面を平坦化する。例えば、光学材料27Mの下面の表面荒れやうねりが無くなるように研磨する。好ましくは、基材41の凹部41Bの対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層27の下面を研磨する。または、基材41の凹部41Bの周囲の平坦部（または平坦面）と層27の上面とが平行もしくは略平行になるように層27を研磨する。

【0107】

また、硬化した層37の表面を平坦化する。例えば、光学材料37Mの上面の表面荒れやうねりが無くなるように研磨する。好ましくは、基材41の凹部41Uの対称軸に対して垂直な平坦面が形成されるように、層37の上面を研磨する。または、基材41の凹部41Uの周囲の平坦部（または平坦面）と層37の上面とが平行もしくは略平行になるように層37を研磨する。

【0108】

基材41の凹部41B、41Uの周囲の平坦部が露出するように層27、37を研磨することで、図1の光学素子100と同一構造または略同一構造の光学素子を得ることが可能である。

なお、図10(C)の基材41および凹部41B、41Uは、図1の光学素子100の基材101および凹部101B、101Dに各々対応している。

【0109】

光学素子の製造方法の第6の実施の形態

図11は、光学素子の製造方法の第6の実施の形態を示す概略的な説明図である。この製造方法により、図1の光学素子100と同一機能または略同一機能を有する光学素子を得ることが可能である。

【0110】

図11(A)の基材51は、対向面のうち一方の面に凹部51Bを有し、他方の面に凹部51Uを有する。凹部51B、51Uは、回転対称または略回転対称な形状を有し、凹部51B、51Uの対称軸は同一直線上もしくは略同一直線上に位置している。基材51のうち凹部51U、51Bの周囲は、平坦になっている。基材51は、光学材料51Mからなる。

凹部 51U, 51B の大きさは、図 1 中のレンズ 102, 103 の大きさと同一である。

この基材 51 は、例えば、図 2 (C) 中の基材 6、図 5 (F) 中の層 10₁, 10₂ が接合された基材 11、図 7 (E) 中の層 20₁, 20₂ が接合された基材 21、または、図 9 (C) 中の基材 31 を用いる。

【0111】

図 11 (B) では、基材 51 の一方の面の凹部 51B に、光学材料 51M とは屈折率が異なる液状の光学材料 47A を満たす。光学材料 47A としては、例えば、光学油、液晶等の光学液体を用いる。

そして、基材 51 の一方の面に光学材料 47M からなる層 47 を形成し、光学材料 47A が満たされた凹部 51B を層 47 により密閉する。このようにして、凹部 51B に液状の光学材料 47A を充填することができる。

【0112】

次に、基材 51 の他方の面の凹部 51U に、液状の光学材料 57A を満たす。この光学材料 57A は、光学材料 47A と同じ材料とする。

そして、基材 51 の上面に光学材料 57M からなる層 57 を形成し、光学材料 57A が満たされた凹部 51U を層 57 により密閉する。このようにして、凹部 51U に液状の光学材料 57A を充填することができる。

層 47, 57 は、一定または略一定の厚さの膜とすることが好ましい。また、層 47, 57 の光学材料 47M, 57M は同じ材料とし、層 47 の厚さは、層 57 の厚さと同一または略同一とすることが好ましい。

なお、図 11 (B) の基材 51 および凹部 51B, 51U は、図 1 の光学素子 100 の基材 101 および凹部 101B, 101D に各々対応している。

【0113】

ところで、モールドレンズに使用されるガラスの屈折率は、一例として 1.4 ~ 1.7 である。

本発明に係る光学素子の光学材料、特に基材の凹部に充填される大きい屈折率（または高い屈折率）の光学材料には、例えば、酸化アルミニウム（例えば屈折率が約 1.8 の Al_2O_3 ）、酸化チタン（例えば屈折率が約 2.5 の TiO_2

）、酸化タンタル（例えば屈折率が約 2.4 の Ta_2O_5 ）、リン化ガリウム（例えば屈折率が約 3.3 の GaP）等が使用可能であり、上記光学材料を用いることで、開口数が多い光学素子を作成可能である。

【0114】

また、本発明に係る光学素子の光学材料、特に基材の凹部に充填される光学材料には、 $Ta_{X1}O_{Y1}$ 、 $Ti_{X2}O_{Y2}$ 、 $Al_{X3}O_{Y3}$ 、 $Si_{X4}O_{Y4}$ 、 $Si_{X5}N_{Y5}$ 、 $Mg_{X6}F_{Y6}$ 、 $Ga_{X7}N_{Y7}$ 、 $Ga_{X8}P_{Y8}$ 、 $Ti_{X9}Nb_{Y9}O_{Z9}$ 、 $Ti_{Z6}Ta_{Z7}O_{Z8}$ 、 $Nb_{Z4}O_{Z5}$ 等の化合物を使用可能である。但し、 $X1 \sim X9$ 、 $Y1 \sim Y9$ 、 $Z4 \sim Z9$ は、前記化合物が存在し得るような数値である。

なお、上記実施の形態は本発明の例示であり、本発明は上記実施の形態に限定されない。

【0115】

【発明の効果】

以上に説明したように、本発明に係る光学素子の製造方法によれば、基材の凹部を小型化可能であり、小型の光学素子を作成可能である。また、本発明に係る光学素子の製造方法によれば、小型で開口数が多い光学素子を作成可能である。

また、本発明によれば、上記製造方法から作成可能な光学素子と、当該光学素子を用いた光学系とを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る光学素子の実施の形態を示す概略的な構成図である。

【図2】

本発明に係る光学素子の製造方法の第1の実施の形態を示す概略的な説明図である。

【図3】

図2に続いて、本発明に係る光学素子の製造方法の第1の実施の形態を示す概略的な説明図である。

【図 4】

本発明に係る光学素子の製造方法の第 2 の実施の形態を示す概略的な説明図である。

【図 5】

図 4 に続いて、本発明に係る光学素子の製造方法の第 2 の実施の形態を示す概略的な説明図である。

【図 6】

本発明に係る光学素子の製造方法の第 3 の実施の形態を示す概略的な説明図である。

【図 7】

図 6 に続いて、本発明に係る光学素子の製造方法の第 3 の実施の形態を示す概略的な説明図である。

【図 8】

本発明に係る光学素子の製造方法の第 4 の実施の形態を示す概略的な説明図である。

【図 9】

図 8 に続いて、本発明に係る光学素子の製造方法の第 4 の実施の形態を示す概略的な説明図である。

【図 1 0】

本発明に係る光学素子の製造方法の第 5 の実施の形態を示す概略的な説明図である。

【図 1 1】

本発明に係る光学素子の製造方法の第 6 の実施の形態を示す概略的な説明図である。

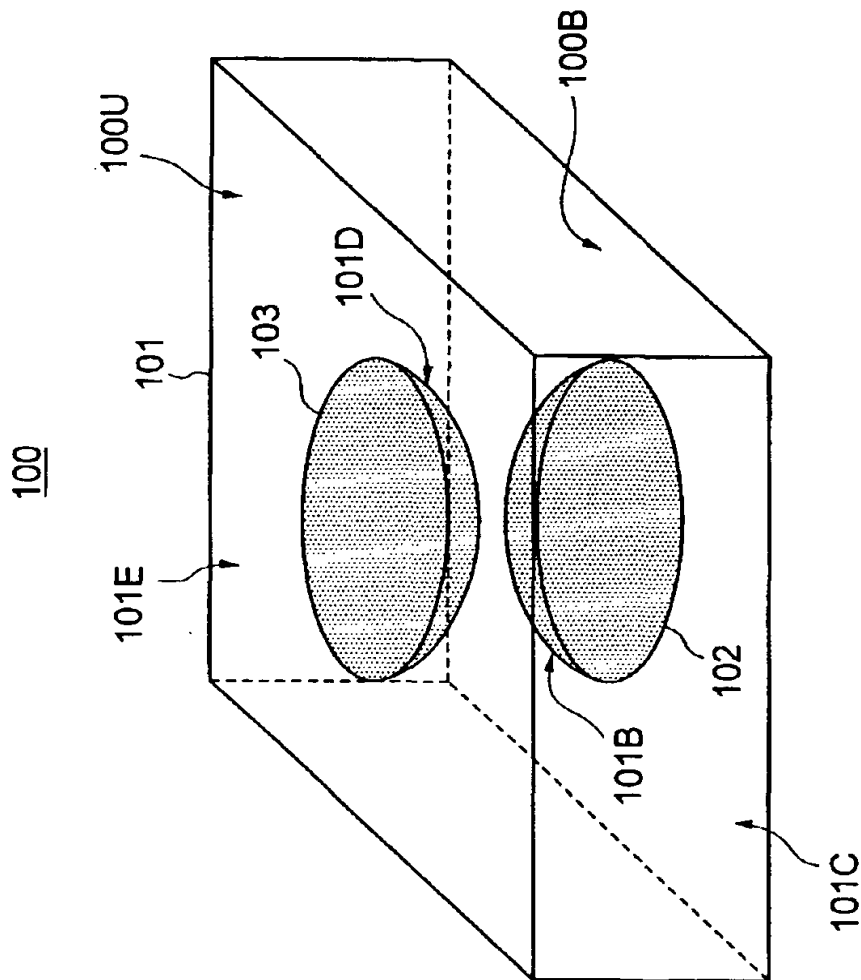
【符号の説明】

3 … 金型、3 C … 空洞（キャビティ）、4 … 通路、5, 5 A, 8 U, 8 U₁, 8 U₂, 2 0 U … 凸部、6, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 1 0 1 … 基材、6 B, 6 U, 7 B, 1 0 B, 1 0 B₁, 1 0 B₂, 2 0 B, 1 0 1 B, 2 7 U, 3 1 B, 3 1 U, 4 1 B, 4 1 U, 5 1 B, 5 1 U, 7 1 U, 1 0 1 B, 1 0 1 D

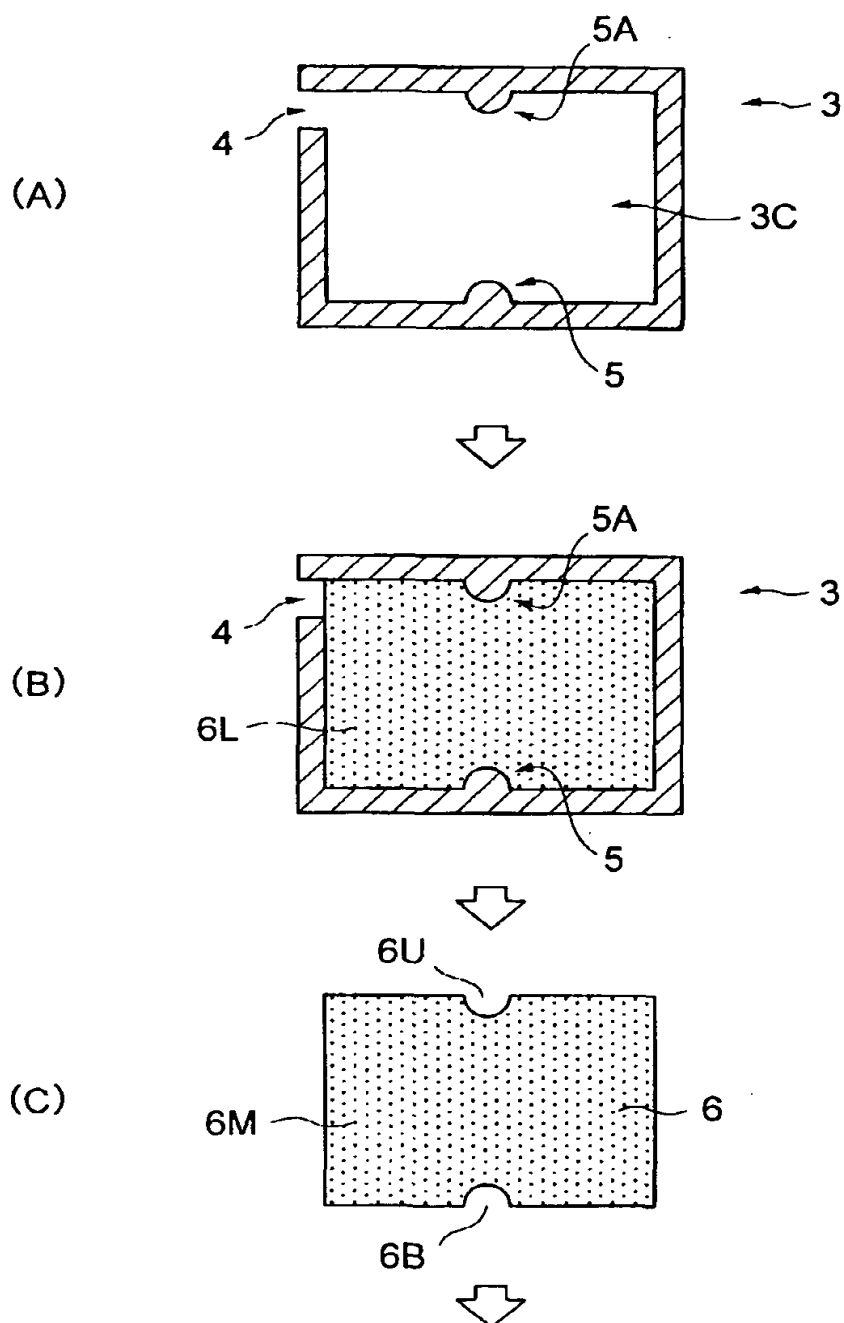
…凹部、6L, 6M, 7M, 10M, 11M, 20M, 21M, 27M, 31M, 37M, 41M, 47A, 47M, 51M, 57A, 57M, 71M…光学材料、7, 10, 10₁, 10₂, 20, 20₁, 20₂, 27, 37, 47, 57, 71…層、8, 8₁, 8₂, 18, 18₁, 18₂…シリコン基板、9, 19, 19₁, 19₂…レジスト、29, 39…レジスト膜、29H, 39H…窓、32…エッチング液、100…光学素子、100B…下面、100U…上面、101C, 101E…平坦部、102, 103…レンズ。

【書類名】 図面

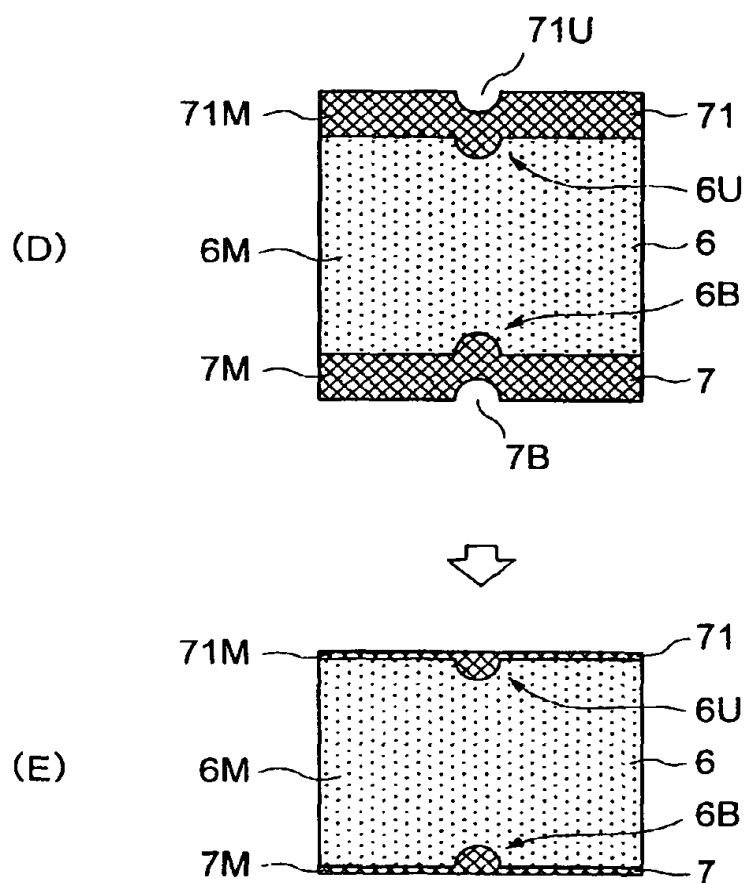
【図 1】



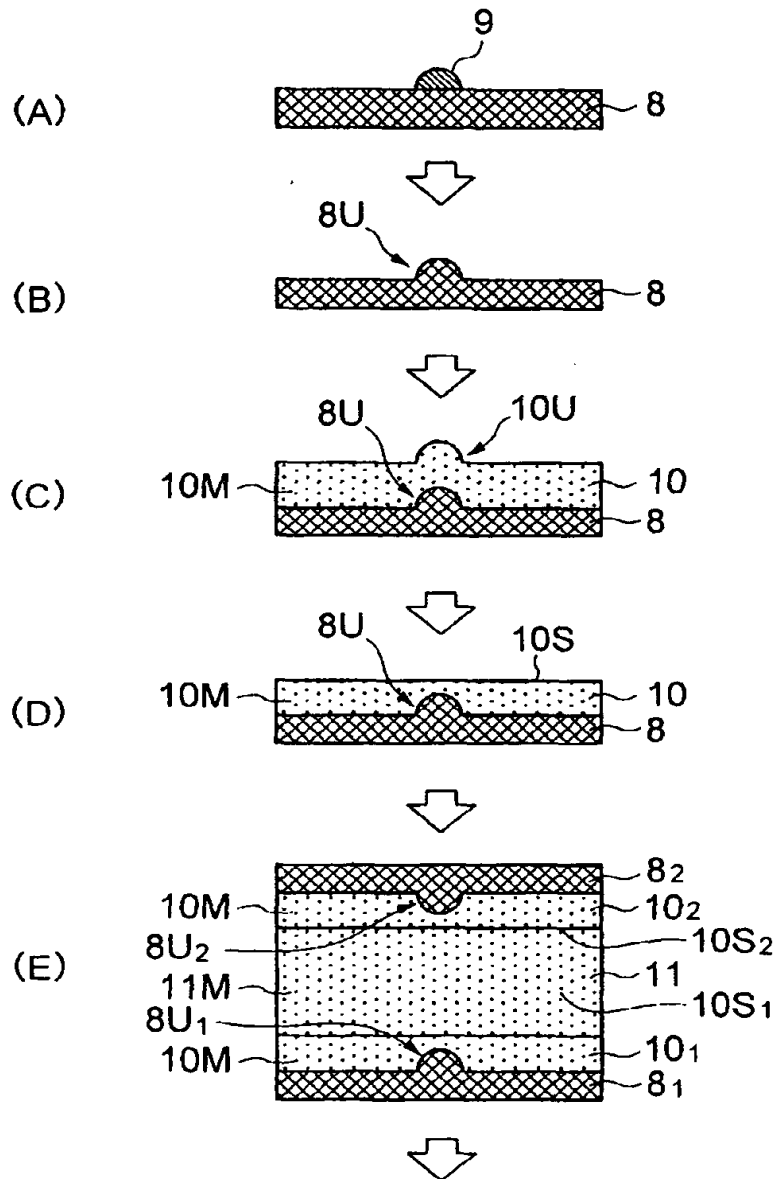
【図 2】



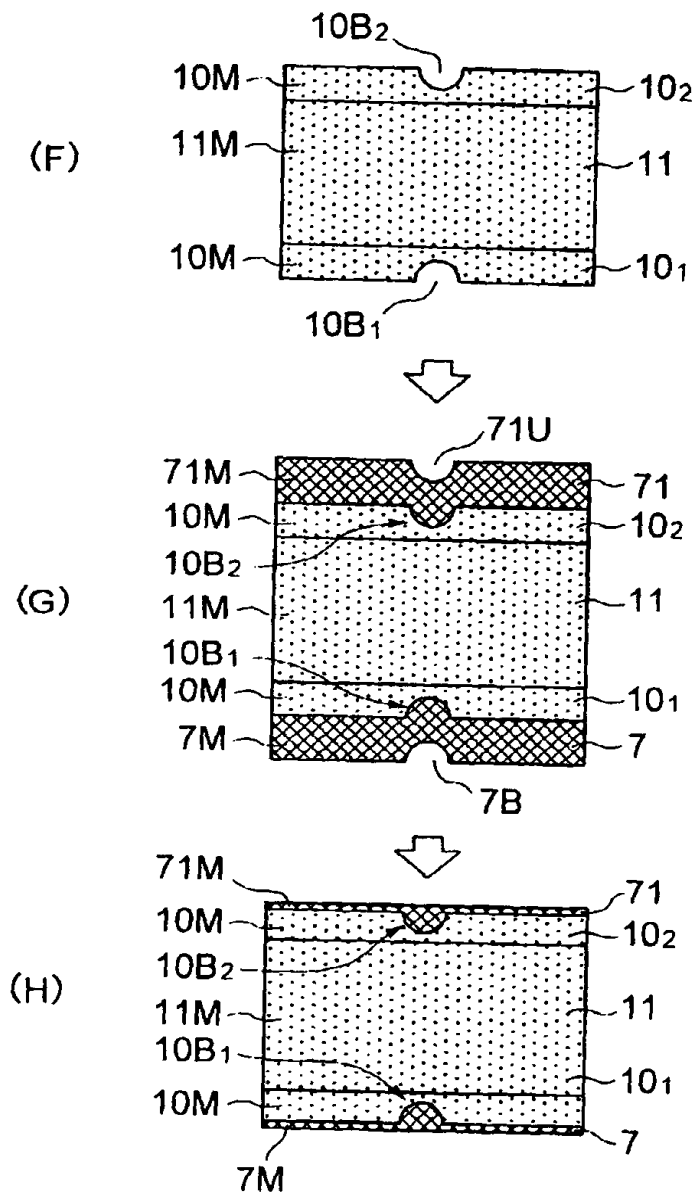
【図 3】



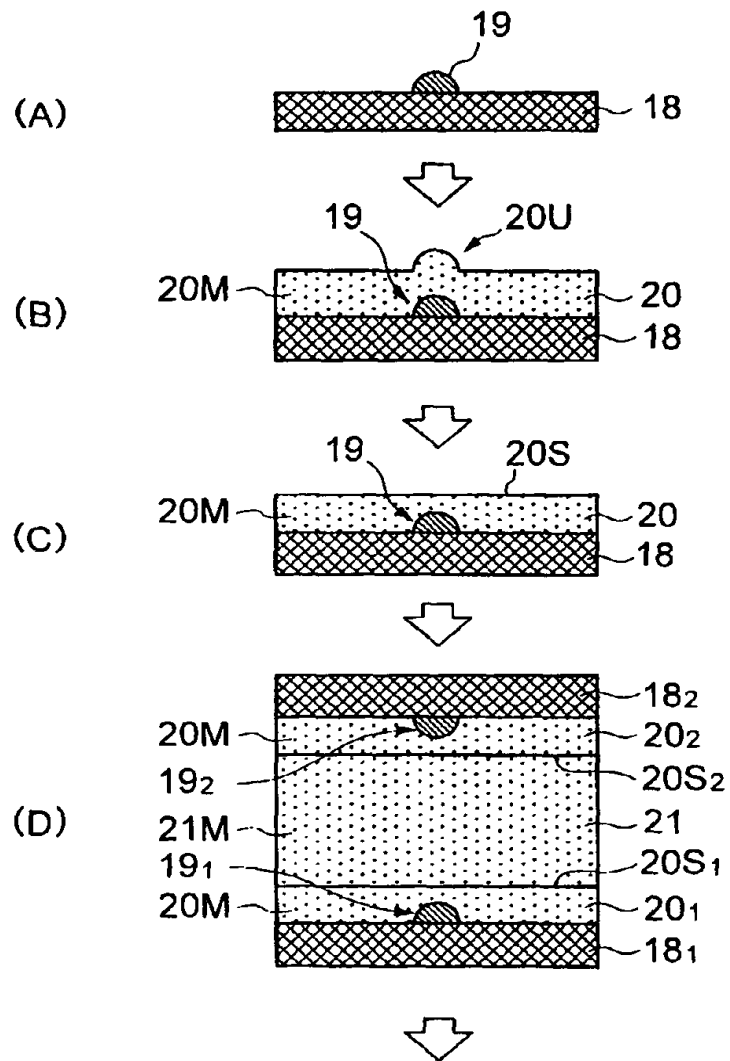
【図 4】



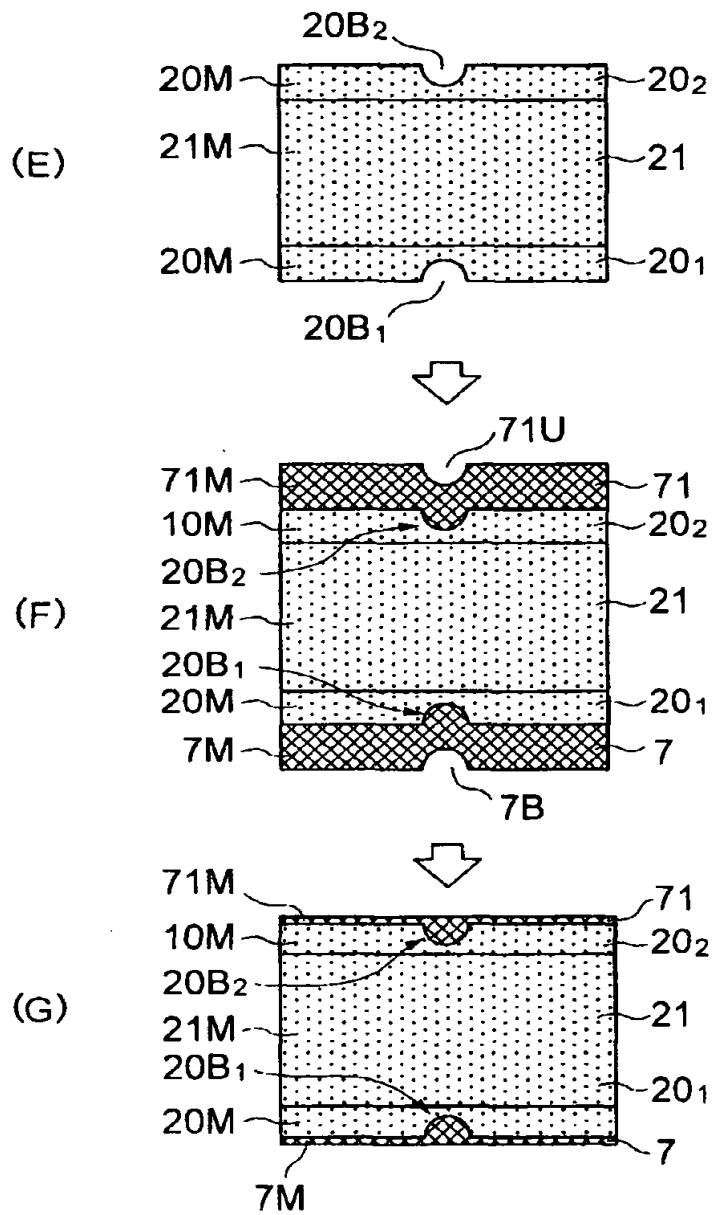
【図 5】



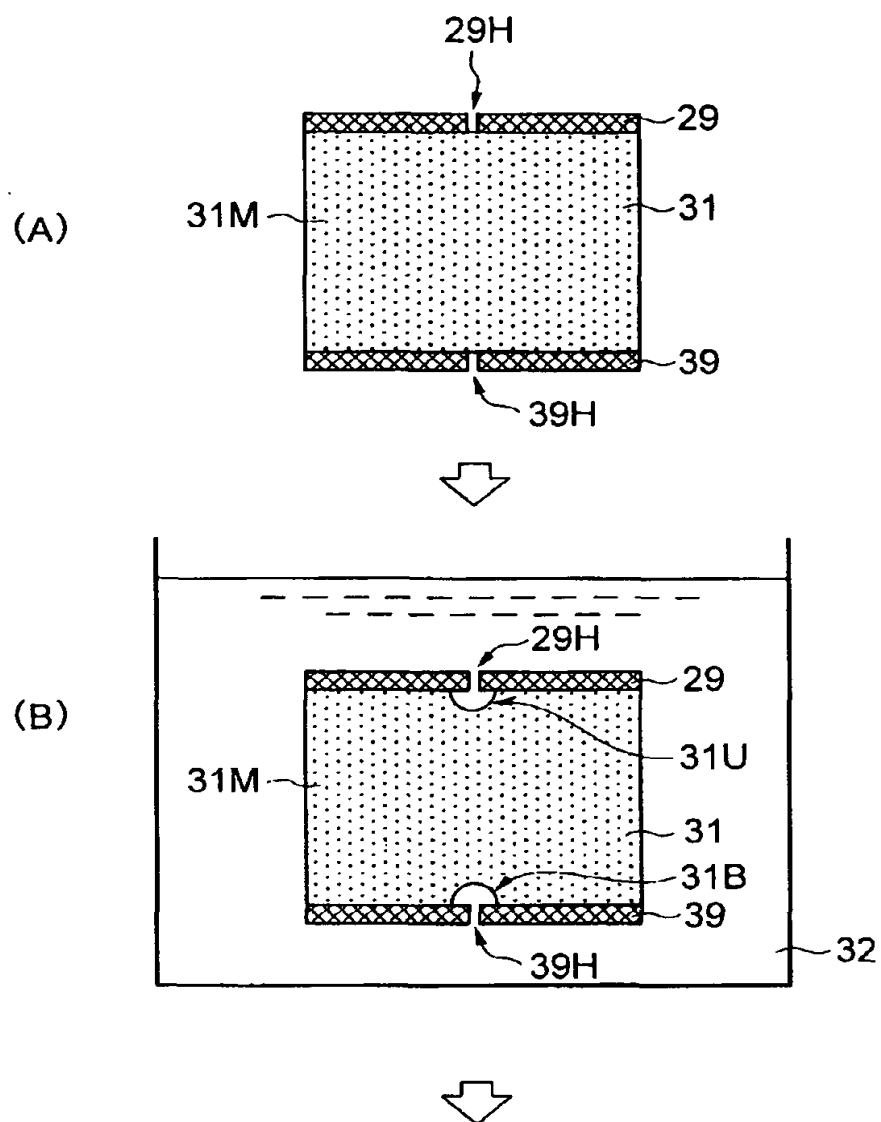
【図 6】



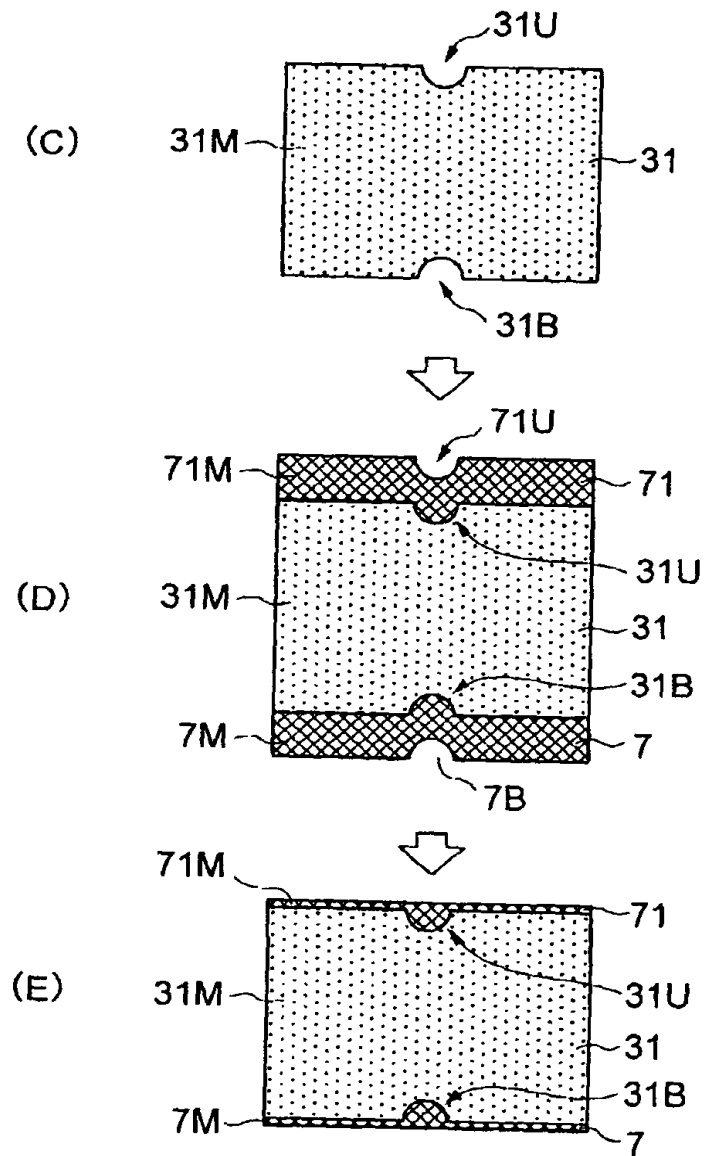
【図 7】



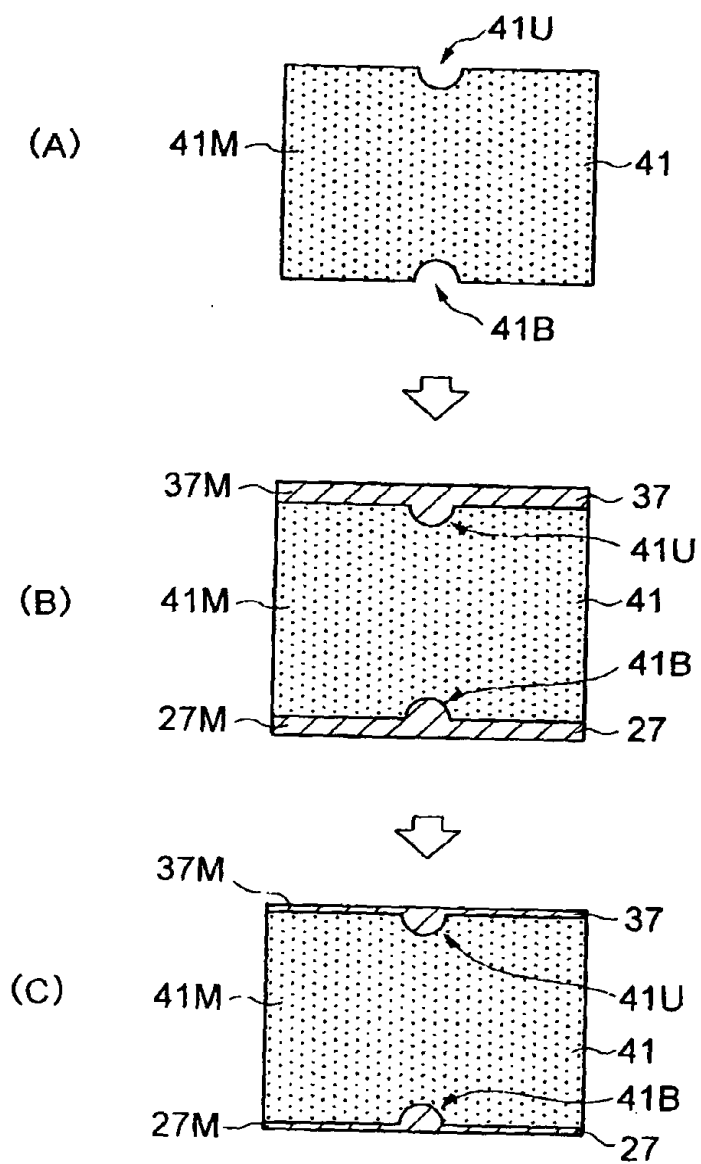
【図 8】



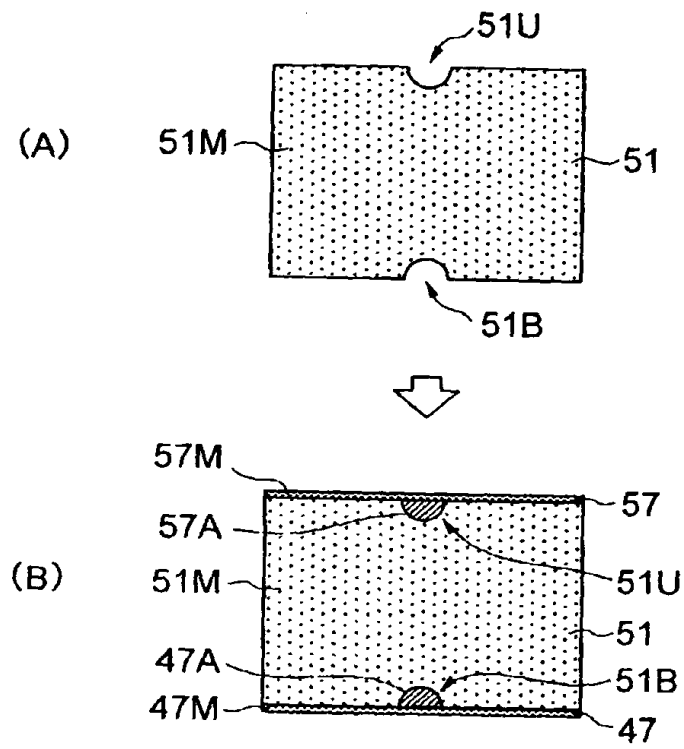
【図 9】



【図 1 0】



【図 11】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 小型で開口数が大きい光学素子を提供する。

【解決手段】 光学素子100は、第1の光学材料からなる基材101と、第1の光学材料とは屈折率が異なる第2の光学材料とを有する。基材101は、互いに対向する第1および第2の面100B, 100Uを有し、第1の面100Bには回転対称な第1の凹部101Bが形成されていると共に、第2の面100Uには回転対称な第2の凹部101Dが形成されている。凹部101B, 101Dには、第2の光学材料が充填されており、レンズ102, 103を構成している。例えば、第1の光学材料を石英とし、第2の光学材料を窒化ケイ素(SiN)またはリン化ガリウム(GaP)とする。凹部101B, 101Dを小さくすることで、レンズ102, 103を小型化可能であり、光学素子100を小型化可能である。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002185]

1. 変更年月日	1990年 8月30日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都品川区北品川6丁目7番35号
氏 名	ソニー株式会社